# BEST AVAILABLE COPY

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-056403

(43)Date of publication of application: 31.03.1984

(51)Int.CI.

G03C 1/68 5/00 // C09D CO9D 11/10 C09J 3/14

(21)Application number: 57-168088

(71)Applicant:

MITSUBISHI CHEM IND LTD

(72)Inventor:

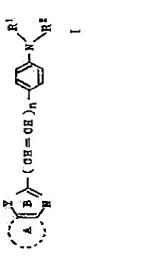
NAGASAKA HIDEKI TAKAHASHI NORIAKI

#### (54) PHOTOMERIZABLE COMPOSITION

(22)Date of filing:

PURPOSE: A photopolymerizable composition highly sensitive to a light source in the visible region, comprising an addition-polymerizable compound having an ethylenically unsaturated double bond and a combination of a specified photoinitiator system and a specified thiol compound.

CONSTITUTION: In a photopolymerizable composition containing an addition- polymerizable compound having at least one ethylenically unsaturated double bond and a photoinitiator system, said photoinitiator system comprises (a) a p-dialkylaminostyrene derivative or pdialkylaminophenylbutadiene derivative of formula I, wherein R1 and R2 are each alkyl, Y is -O-, -S-, or -CH=CH-, or may form a heteroaromatic ring B, together with the trivalent nitrogen atom, and ring A is a benzene ring or a naphthalene ring and is condensed with ring B, and n is 1 or 2, (b) hexaarylbiimidazole, and (c) a thiol compound represented by formula II, wherein Z is -O-, -S-, -NH-, or -C(O)NH-.





#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office



#### (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

### ⑩公開特許公報(A)

昭59—56403

௵Int. Cl. <sup>3</sup>	識別記号	庁内整理番号	❹公開 昭和59年(1984)3月31日
C 08 F 2/50		7102—4 J	Z\$4用の粉 1
G 03 C 1/68	1.0.0	7267—2H	発明の数 1 審査請求 未請求
// C 09 D 5/00 11/10	102	6516—4 J 6770—4 J	世旦明小 小明小
· C 09 J 3/14		7102—4 J	(全 10頁)
	-		

#### 60光重合性組成物

②特 願 昭57-168088

②出 願 昭57(1982)9月27日

⑩発 明 者 長坂英樹

横浜市緑区鴨志田町1000番地三 菱化成工業株式会社総合研究所

内

#### 仰発 明 者 髙橋徳明

横浜市緑区鴨志田町1000番地三菱化成工業株式会社総合研究所

の出 願 入 三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番2号

個代 理 人 弁理士 長谷川一 外1名

#### 明 細 書

- / 発明の名称 光重合性組成物
- 2 特許請求の範囲
  - (1) エチレン性不飽和二重結合を少くとも/個有する付加重合可能な化合物および光重合開始系を含む光重合性組成物において、該光重合開始系が、
    - (a) 一般式

$$\langle A \rangle \left(B_{N}^{Y}\right) - (OH = OH)_{n} \rangle V \langle R^{1} \rangle$$

「式中、 d および d は T ルキル基を示し、 I は −0−、 −8− および −CE=OB− より 選ばれ た 2 価原子または原子団であつて 3 価 選 案 原子と共に復業芳香環 B を形成しており、 銀 Δ はペンセン環またはナフタリン環であ つて選 B と縮合している。

nは / または 2 を 表わす。 ] で示される p - ジアルキルアミノスチルペン誘導体ま たはPージアルキルアミノフエニルブタジエニル誘導体、

- (b) ヘキサアリールピイミダソール、および
- (c) 一般式

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{Z}}$$
 8H

【式中、 2 は −0− , −8− , −NB− および −C NB− より選ばれた 2 価原子 または原子団 ┃ 0

を扱わす。〕で示されるチオール化合物か ら成ることを特徴とする光重合性組成物。

- (2) エチレン性不飽和二重結合を有する付加重 合可能な化合物が、アクリル酸エステルまた はメタクリル酸エステル化合物である特許 球の範囲第/項記載の組成物。
- (3) pージアルキルアミノスチルペン誘導体またはpージアルキルアミノフェニルブタジェニル誘導体が、2-(pージアルキルアミノスチリル)ーペンゾ(x,s]ペンゾチアゾー

ル、2-(p-ジアルキルアミノスチリル)-ベンゾチアゾールまたは2-(p-ジアルキルアミノスチリル)-ベンゾオキサゾールである特許請求の範囲第/項記載の組成物。

- (4) ヘキサアリールピイミダゾールが 2,2' ーピス ( 0 ー クロロフエニル )-\*, \*', \*, \*' ーテトラフエニルピイミダゾールまたは 2,2' ーピス ( 0 ープロモフエニル ) ー \*, \*', \*, \*' ーテトラフエニルピイミダゾールである 特許請求の範囲第 / 項記載の組成物。
- (5) チォール化合物が、2ーメルカブトーペンメテアソールまたは2ーメルカブトーペンズォキサゾールである特許請求の範囲第/項記載の組成物。
- 3 発明の詳細な説明

本発明は光重合性組成物に関するものである。 特に可視領域の光源に対し高感度を示す光重合 性組成物に関するものである。

従来、光重合系利用の画像形成伝は多数知られており、例えば付加重合可能なエチレン性二

**- 3 -**

の光重合開始剤は 《 O o n m 以下の紫外線領域の 光源に対する光重合開始能力に比較し、 《 O o n m 以上の可視光線領域の光源に対するそれは 類響に低く、従つてそれらを含む光重合性組成 物の応用範囲を著しく限定してきた。

重結合を含む化合物と光重合開始剤、 さらに所 望により用いられる有機高分子結合膜、熱重合 禁止剤、着色剤、可塑剤等からなる光重合性組 成物を調製し、この光重合性組成物を無容媒ま たは榕液となし支持体上に塗布して光重合性組 成物の層を設けた感光材料を作成し所望画像を 像露光して酵光部分を重合硬化させ未露光部分 を溶解除去することにより硬化レリーフ画像を 形成する方法や上述感光材料が少なくとも一方 が透明である2枚の支持体間に光重合性組成物 の僧を設けたものであり、透明支持体側より像 露光し光による接着強度の変化を惹起させた後 支持体を剝離することにより画像を形成する方 法その他光取合性組成物層の光によるトナー附 殖性の変化を利用した画像作成方法等がある。 か様な方法に応用される光重合性組成物の光重 合開始剤としては従来、ペンソイン、ペンソイ ンアルキルエーテル、ペンゾフェノン、アント ラキノン、ペンジル、あるいはミヒラーケトン などが用いられてきた。しかしながら、これら

- 4 -

色素の系(特開昭 5 % - / 5 / 0 2 % ) などの 提案がなされてきた。これら技術は確かに可視 光線に対し有効ではあるが、未だその感光速度 は充分満足すべきものではなくさらに改良技術 が望まれていた。

本発明者等の一部は、先に、可視光の光顔に対し高感度で感応する光重合性組成物を提案した。(特開昭 5 2 - 2 / 4 0 / 、特顧昭 5 6 - / / 8 3 3 9 )。

本発明者等は、更に検討を重ねた結果、特定の光重合開始系に特定のチオール化合物を併用すれば、より感度の同上した光重合性組成物が得られること、従つて、例えば、アルゴンイオンレーザーを用いたレーザー直接製版等の分野に有利に適用できること、即ちりの製版時間が短縮され、且つ、低出力のレーザーで容易に製版できることを見い出し本発明を完成するに至ったものである。

すなわち、本発明の要旨は、エチレン性不飽 和二重結合を少くとも/個有する付加重合可能 な化合物および光重合開始系を含む光重合性組 成物において、該光重合開始系が、

#### (a) 一般式

$$\left(\begin{array}{c} X \\ B \\ N \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} CH = CH \end{array}\right) + \left(\begin{array}{c} R^1 \\ R^2 \end{array}\right) - \cdots$$

□は!または2を表わす。〕で示されるp ージアルキルアミノスチルペン誘導体または pージアルキルアミノフエニルプタジエニル 誘導体、

- (D) ヘキサアリールピイミダゾール、および
- (c) 一般式

- 7 -

エチレン性不飽和結合を有する単量体としては例えば不飽和カルボン酸、不飽和カルボン酸と脂肪族ポリヒドロキン化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と芳香族ポリヒドロキン化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と多価カルボン酸及び前述の脂肪族ポリヒドロキン化合物等の多価ヒドロキン化合物等の多価ヒドロキン化合物とのエステル化反応により得られるエステル等が挙げられる。

脂肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽和かいがンクリコールの具体例としては、エテングのは体例としては、エテングのロート・リコールシアクリレート・リメチロールエンジョリント・リアクリレート・シスエリスリトールペンタエリスリトールペンタエリスリトールペンタエリスリトールペンタエリスリトールペキサアクリスリスリトールペキカアクリスリスリトールペンタエリスリトールペキカアクリスリトールペンタエリスリトールペンタエリスリトールペキカアクリスリスリスリトールペキカアクリスリスリスリスリスリスリスリスリスリス

〔式中、 Z は −0− , −5− , −NH− および −0NH− より選ばれた 2 価原子または原子団を

表わす。〕で示されるチォール化合物から成ることを特徴とする光重合性組成物に存する。 以下本発明について詳細に説明する。

**-** 8 **-**

ト、グリセロールアクリレート等のアクリル酸 エステル、トリエチレングリコールジメタクリ 、レート、トリメチロールブロパントリメタクリ レート、トリメチロールエタントリメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、 ベンタエリスリトールトリメタクリレート、ベ ンタエリスリトー ルテトラメタクリレート、ジ ペンタエリスリトールジメタクリレート、ジベ ンタエリスリトールトリメタクリレート、ジベ ンダエダスリトールテトラメタクリレート等の メタクリル散エステル、エチレングリコールジ イタコネート、テトラメチレングリコールジイ タコネート、ペンタエリスリトールトリイタコ オート等のイタコン酸エステル、エチレングリ コールジクロトネード、ジェチレングリコール ジクロトネート、ペンタエリスリトールテトラ クロトオート等のクロトン酸エステル、エチレ ングリコールジマレエート、トリエチレングリ コールジマレエート、ペンタエリスリトールジ マレエート等のマレイン酸エステルがある。

芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステルとしては、ハイドロキノンジアクリレート、ハイドロキノンジメタクリレート、レゾルシンジアクリレート、レゾルシンジメタクリレート、ピロガロールトリアクリレート等が挙げられる。

不飽和カルボン酸と多価カルボン酸及び多価
ヒドロキシ化合物とのエステル化反応により得
られるエステルとしては必ずしも単一物では低
いが代表的な具体例を挙げれば、アクリル酸
なマレイン酸はよびエチレンの超合物、
フタルの
配合物、メタクリル酸、テレフタル
は
なのなった。
なのなった。
なのなった。
なのなった。
ないなった。
ないなった。

その他本発明に用いられるエチレン性不飽和 二重結合を有する化合物の例としてはエチレン ヒスアクリルアミド等のアクリルアミド類、フ タル酸ジアリル等のアリルエステル類、ジビニ

-11-

くとも / 個有する付加重合可能な化合物の内、 アクリル酸エステル類またはメタクリル酸エス テル類の単量体が特に好適に使用できる。

次に本発明の光重合性組成物の第2の必須成分である光重合開始系について説明する。光重合開始系は活性光線の照射によりラジカルを発生し前述のエチレン性不飽和結合を有する化合物の付加重合反応をもたらすものである。本発明の光重合開始系は3種類の成分の組合せより成つておりその第1の成分(a)は前配一般式[1]で表わされるロージアルキルアミノフェニルブタジエニル誘導体である。

式中、RおよびRはメチル基またはエチル基 であるものが好ましい。

具体的には、例えば、2-( p-ジメチルア ミノスチリル)-ベンゾチアゾール、2-( p -ジエチルアミノスチリル)-ベンゾチアゾー ル( a-/)、2-( p-ジメチルアミノスチ リル)-ベンゾオキサゾール( a-2)、2ルフタレート等のビニル基含有化合物などが有用である。

主鎖にエチレン性不飽和結合を有する重合体 は例えば不飽和二価カルポン酸とジヒドロキシ 化合物との重縮合反応により得られるポリエス テル、不飽和二価カルポン酸とジアミンとの重 稲合反応により得られるポリアミド等がある。 側鎖にエチレン性不飽和結合を有する重合体は 偶鎖に不飽和結合をもつ二価カルポン酸例えば イタコン酸、プロピリデンコハク酸、エチリデ ンマロン酸等とジヒドロキシまたはジアミン化 合物との縮合重合体がある。また何鎖にヒドロ キシ基やハログン化メチル基の如き反応活性を 有する官能基をもつ重合体、例えばポリビニル アルコール、ポリ ( ユーヒドロキシエチルメタ クリレート)、ポリエピクロルヒドリン等と( メタ)アクリル酸、クロトン酸の様な不飽和カ ルポン酸との高分子反応により得られるポリマ - も好適に使用し得る。

以上記載したエチレン性不飽和二重結合を少

- 12 -

( p - ジェチルアミノスチリル ) - ペンゾオキ サゾール、 4 - ( p - ジメチルアミノスチリル) ーペンゾ( ヾ,ゞ ] ペンゾチアゾール( ェーョ)、 2-(p-ジェチルアミノスチリル)ーペンゾ [ 4,5 ] ペンソチアソール ( ェー 4 )、 2 -( p - ジェチルアミノスチリル ) - ペンゾ [ 6, 2 ] ベンゾチアゾール、ュー(p-ジメチルア ミノスチリル ) ーキノリン(a-s)、a-(p-ジェチルアミノスチリル)-キノリン、 3-(p-ジェチルアミノスチリル)ーペンゾ [ 4,5 ] ペンソオキサゾール等の p ージアルキ ルアミノスチリル誘導体。ユー〔メー(pージ メチルアミノフエニル ) ー 1.3 - プタジエニル] ーペンゾチアゾール(ヨーゟ)、2ー[ドー ( p - ジェチルアミノフェニル ) - 1,3 - ブタ ジェニル ] ーペンソチアソール、ユー( 4 ー (p-ジーロープチルアミノフエニル)-1,3-ブタジエニルリーペンゾチアゾール、ユー[ド - ( p - ジメチルアミノフエニル ) - 1,3 - プ タジエニル]ーペンゾ[ 4,7 ]ペンゾチアゾー

ル ( a - 2 )、 a - [ \* - ( p - ジェチルアミ ノフエニル ) - 1,3 - ブタジエニル ] - ペンゾ [ \*,5 ] ペンゾチアゾール ( a - 8 ) 等のジア ルキルアミノフエニルブタジエニル誘導体等を 挙げることができる。

これらは相当する p ー ジアルキルアミノベン メアルデヒドまたは桂皮アルデヒドと 2 ー メチルー 複架型との縮合反応、例えば、「 Zhur. Obshchei Khim <u>26</u>, 2891~6(1956) 」配 級の方法により合成し得る。

第2の成分(D)はヘキサアリールピイミダゾールである。これは2.4,5- トリアリールイミダゾリル二量体とも呼ばれ2個のイミダゾールが/個の共有結合で結ばれた構造を有する化合物である。

前配アリール基としてはフェニル基が好ましい。かかるフェニル基は置換基を有していてもよく、特に2位およびご位のフェニル基のオルト位が弗器原子、塩素原子、臭素原子、ニトロ基、メチル基で置換されたヘキサフェニルビイ

- 15 -

例えば Bull. Chem. Soc. Japan, <u>33</u>, 565 (/960) および J. Org. Chem., <u>36</u> [/6] 2262 (/97/) に開示されている方法により容易に 合成することができる。

我々は更に高感度化を目指して種々検討を試みた結果、前述の2成分に、更に特定のチオール化合物を添加することにより数倍の感度改善がなされることを見い出した。

チオール化合物は代表的なラジカル連鎖移動 剤として知られているが、後述の参考例 / ~ 3 に従来の代表的光重合開始系へのチオール化合 物添加による感度に及ぼす効果を示したが、特 足の重合開始系に添加してはじめて感度の大幅 な改善効果が達成されるのである。

本発明の成分(c)として用いられるチオール化 合物は前記一般式 [II] で示されるものであつて、 具体的には、 2 ーメルカプトペンズチアゾール ( c ー / )、 2 ーメルカプトペンズオキサゾー ル( c ー 2 )、 2 ーメルカプトペンズイミダゾ ール( c ー 3 )、 2 ーメルカプトー 4 ( 3 H ) ミダゾールが熱安定性、光反応速度の特性面か ち有利である。

特に好ましいヘキサアリールピイミダゾール の具体例としては、2,2′-ピス(0-クロロ フェニル) - 4, 4', 5, 5' - テトラフェニルピイ ミダゾール(ロー/)、2,2'ーピス(ローブ ロモフエニル)ー ¼ , ¼′, 5 , 5′ テトラフエニルビ イミダゾール ( b - 2 ) 、 2,2' - ピス ( 0,P ージクロロフエニル ) ー タ , タ , 5 , 5 ' ー テトラフ エニルピイミダゾール ( ロー3 )、 2,2' ーピ ス ( o ー クロロフエニル ) ー ४, ४, 5, 5' ーテト ラ ( mーメトキシフエニル ) ピイミダゾール、 2,2′ -ビス(0,0′-ジクロロフエニル)-¥, ¥', s, s' -テトラフエニルピイミダゾール ( b - # ), 2,2' - Yx ( 0 - = h u 7 x = ル)ーダ、ダ、5、3'ーテトラフエニルピイミダゾ - ル ( b - s )、2,2' - ピス ( 0 - メチルフ エニル)ーゼ,ゼ,ゟ,ゟ'ーテトラフエニルピイミ メソール ( b - 6 ) 等が挙げられる。

これらのヘキサアリールピイミダゾール類は

- 16 -

- キナゾリノン ( c - 4 ) を挙げることができる。

本発明の光重合性組成物に用いられる構成成分(a)、成分(b)、成分(c)の好通な使用量はエチレン性付加重合可能な化合物 / 0 0 重量部に対し、成分(a) 0./~/0、好ましくは /~/重量部、成分(b) 0.5~30、好ましくは 2~/5 重量部、成分(c) 0./~20、好ましくは /~/5 重量部の創合で用いられる。

本発明の光重合性組成物は前記の各構成成分の他に本組成物の改質、光硬化後の物性改善の為に結合剤として有機高分子物質を更に添加な性、ることができる。結合剤は相溶性、皮膜形成性、現像性、接着性等改善目的に応じて適性改善には(メタ)アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共生セルロース変性物、ポリエチレンオキシド、ポリピニルピロリドン等があり、皮膜強度、接着性の改善に

はエピクロロヒドリンとピスフェノールAとの ポリエーテル、可溶性ナイロン、ポリメチルメ メクリレートの様なポリメタクリル酸アルキル やポリアクリル酸アルキル、メタクリル酸アル キルとアクリロニトリル、アクリル酸、メタク リル酸、塩化ビニル、塩化ビニリデン、スチレ ン等との共重合体、アクリロニトリルと塩化ビ ニル、塩化ビニリデンとの共重合体、塩化ビニ リデン、塩素化ポリオレフイン、塩化ビニルと 酢酸ビニルとの共重合体、ポリ酢酸ビニル、ア クリロニトリルとスチレンとの共重合体、アク リロニトリルとブタジエン、スチレンとの共重 合体、ポリビニルアルキルエーテル、ポリビニ ルアルキルケトン、ポリスチレン、ポリアミド、 ポリウレタン、ポリエチレジテレフタレートイ ソフタレート、アセチルセルローズポリピニル ブチラール等を挙げることができる。これらの 結合剤はエチレン結合を有する化合物に対し重 **量比率でよ00%以下、好ましくは200%以** 下の範囲で添加混合することができる。

- 19 --

ケート、トリアセチルグリセリン等がありエチレン性不飽和二重結合基を有する化合物と結合 剤との合計重量に対しまる以下添加することが できる。

本発明の光重合性組成物を用いて感光材料を 調製する際に適用される支持体としては例えば アルミニウム、マグネシウム、銅、亜鉛、クロ ム、ニッケル、鉄等の金斑またはそれらを主成 分とした合金のシート、上質紙、アート紙、剝 本発明の光重合性組成物は必要に応じ更に熱 重合防止剤、潛色剤、可塑剤、表面保護剤、平 滑剤、塗布助剤等な加することができる。

、熱重合防止剤としては例えばハイドロキノン、 pーメトキシフエノール、ピロガロール、カテ コール、 2,6-ジーモーブチルー p ークレゾー - ル、β-ナフトールなどがあり着色剤として は例えばフタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、 カーポンプラック、酸化チタンなどの顕料、エ チルパイオレツト、クリスタルパイオレツト、 アソ系染料、アントラキノン系染料、シアニン 系染料がある。<br />
これら熱重合防止剤や着色剤の 添加量はエチレン性不飽和二重結合を有する化 合物と結合剤との合計質量に対し数面会防止剤 が 0.01 まないし3 ま、 着色剤 0.1 まないし 20分が好ましい。可盟剤としては例えばジオ クチルフタレート、ジドデシルフタレート、ト リエチレングリコールジカブリレート、ジメチ ルグリコールフタレート、トリクレジオホスフ エート、ジオクチルアジペート、ジプチルセバ

- 20 <del>-</del>

離紙の様な紙類、ガラス、セラミックスの如き 無機シート、ポリエチレンテレフタレート、ポ リエチレン、ポリメチルメタクリレート、塩化 ビニル、塩化ビニルー塩化ビニリデン共重合体、 ポリスチレン、6ーナイロン、セルローストリ アセテート、セルロースアセテートプチレート の様なポリマーシートなどがある。

また本発明の光重合性組成物はさらに酸素による感度低下や保存安定性の劣化等の悪影響を防止する為の公知技術、例えば、感光層上に剝離可能な透明カバーシートを設けたり酸素透過性の小さいロウ状物質、水溶性ポリマー等による被覆層を設けることもできる。

本発明の組成物に適用し得る露光光源としてはカーボンアーク、高圧水銀短、キセノンランブ、メタルハライドランブ、 盤光ランブ、 タングステンランブ、 アルゴンイオンレーザー等 / \* 0 nm 以上の紫外線、 可視光線を含む汎用の光源を好適に使用し得る。

本発明の光重合性組成物は広範囲な応用分野

に有用であつて例えば平版、 凹版、 凸版等印刷版の作成、ブリント配線や I O の作成の為のフォトレジスト、ドライフイルム、 レリーフ像や画像複製などの画像形成、光硬化性のインク、 塗料、接着剤等に利用できるが特に可視光線の 光源を用いる応用分野に有効である。

以下本発明を実施例ならびに比較例、参考例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

なお、文中で用いた各成分名の略号は本文中 に記載したものを用いており、添加量はエチレン性単量体と結合剤との合計重景に対する重量 まで示している。

奥施例/および比較例/~3

ポリメチルメタクリレート BR-83(三菱レイョン社製)を常法により20molの部分加水分解して得たメチルメタクリレート/メタクリル欧共重合体(結合剤)/.0g、トリメチロールブロパントリアクリレート(大阪有機化学工業社製)/.0g、p-メトキンフェノール6mx

- 23 -

表 /

	成 分 (a) [添加量]	成 分 (b) [添加益]	成 分 (c) [ 添加量]	感度
奥施例!	n-4[2.5%]	D-/(5%)	c-/[5%]	7 (段)
比較例/		# #		3
, 2	" "		0-/[5%]	0
, 3	-	b-/(5%)	n n	0

実施例!は比較例!~3に比し《倍以上の感 度を有していることがわかつた。

奥施例2~クおよび比較例4~?

実施例 / に記載した感光液原液に成分(D)として b - 2を s 重量 s 添加溶解 し、成分(a) および成分(c) は 表 2 に示した化合物 を 添加 した以外は 実施例 / と同様条件下で FF 価 した。



ピクトリアピエアブルーBOH(保土谷化学工 **弾社製) 6 叫をメチルエチルケトン 1 8 8 中に 溶解し、感光液原液を調製した。この原液に裂** ノに示す添加成分を配合溶解し、これを砂目立 てかつ陽極酸化を施したアルミニウムシート上 にホワラーを用い、乾燥膜厚 2 μm となる様に 強布し、次いで80℃、5分間乾燥した。その 表面に更にポリピニルアルコール水格液を造布 し、乾燥膜β 3 μm のオーパーコート層を設け、 試料を作成した。次いで真空協権中にてステッ ブタプレット (イーストマンコタック社製)を 前記試料に重ね露光した。露光条件はキセノン 俎より色ガラスフイルターY- 4 7 、および干 我フィルター E L - 49 (共に東芝ガラス社製) の両者を通して得られる 490 mm 前後の波長 の光線(光強度/.0 mw/cml)を / 0 秒間照射し た。露光後、プチルセロソルプ9嵐豊多、ケイ 酸ソーダノ重盤を含む水溶液により現像を行 ない、得られた光硬化画像の段数により感度を 測定した。結果を表!に示す。

- 24 -

表 2

	成分(4)[抵加量]	成分(0)〔徐加盐〕	悠 度
実施例 2	a-4 [2.5%]	0-2(3%)	2 (段)
<i>y 3</i>	B-8 #	, ,	7
. 4	a-7 /	, ,	6.5
1 5	a-3 //	, ,	7
1 6	a-4 "	c-3 //	6.5
1 7	, ,	c-#[2%]	5.5
比較例《	2-4 "		3
, 5	a-8 .	_	2.5
, 6	8-7 #	_	3
1 7	a-3 #		2.5

#### 実施例を~/2および比較例を~/2

実施例 / に配数の感光液原液に成分(b) として b - 2を 1 重量 5 添加溶解し、成分(a) および成 分(c) は 表 3 に示した化合物を 添加し、 更に 露光 条件として 高圧 水銀 金から 色 ガラスフィルター L - 4 2 および干渉フィルター 8 L - 4 3 (共 に東芝ガラス社製)の両者を辿して得られる波長436nm (光強度0.065mm/cd)を50秒間露光した以外は更施例/と同様な条件下で評価した。結果を表-3に示す。

表 3

	成分(a) [添加量]	成分(0)[修加劃]	感 度
奥施例 8	a-4 [2.5 %]	c-2 [5%]	5.5 段
# 9	a-5 #	<i>n n</i>	4
, 10	a-2 "	# 11	5.5
11 //	n-/ //	R H	5
11 / 2	a-6 #	п п	\$
比較例 8	a-4 #		2
# 9	a-5 n	_	0
11 10	a-2 "	. —	2
" //	a-/ "		/
1 / 2	2-6 #		/

実施例/3~/6 および比較例/3、/4 実施例/で用いた感光液原液に成分(n)として

- 27 -

表 ケ

	エチレン性単量体	<b>PS</b> EE
実施例/2	ヘンタエリスリトールトリアクリレート	7 (段)
1 18	ヘンタエリスリトールテトラメタクリレート	7
1 /9	1,6ーヘキサンジオールジアクリレート	6.5
, 20	* 20 クリセリンモノアクリレート	

#### 実施例2/

実施例 / で用いた 試料に対しアルゴンイオンレーザーによる走査 電光を行なつた。 波長 488 nm のレーザー光線を 試料表面上でピーム径 / 5 μm に 架光し光強度 / 5・2 mw 、 走査速度 5/・3 m/sec の条件下で 電光した。 実施例 / と同様な現像を行なつた結果、 線幅 / 5 μm の硬化 面線を 得た。

#### **参考例 / ~ 3**

 a - 4 を 2.5 重量 8、成分(D)および成分(c) として表 4 の化合物を配合した以外は実施例 / と同様な条件下で評価した。結果を表 4 に示す。

表 4

	成分(1)[1	统加量)	成分(0)[	<b>添加登</b> ]	憋	脡
実施例/3	b-3(	5%]	c-/I	[ # # ]	7	(段)
14	b-#	"	,	,	4.	5
15	b-5	,	"	"	5.	5
16	b-6		,	,	5	
比較例/3	b-4	,	-	-	/	
14	b-6	,	_	-	1.	. 5

#### **奥施例 17 ~ 20**

実施例!で用いたトリメチロールブロパントリアクリレートに代え、表よのエチレン性単盤体を用いた以外は実施例!と同様な条件下で評価した。結果を表よに示す。

- 28 -

場合の感度を求め比較した。結果を聚るに示す。

表 6

	光重合開始系	c-/添加効果
参考例/	ベンゾインメチルエーテル	0.5 段啟度低下
, 2	2-エチルアントラキノン	6段膨跃低下
# 3	ペンジル+ミヒラーズケトン	感度変化無し

出顧人 三菱化成工業株式会社 代理人 弁理士 長谷川 一 (tか/名)

#### 特開昭59-56403 (**9**)

#### 手 続 補 正 書(自発)

昭和38年8月23日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

1 事件の表示 昭和よ7年 特 許 願第/ 88 号

2 発 明 の名称 光重合性組成物

3 補正をする者

出 顧 人 (596) 三菱化成工菜株式会社

4 代 理 人 〒100

(ほか 14名)

5 補正の対象

明細書の特許請求の範囲シェび 発明の詳細を説明の概

58. 8.24

- 6 補正の内容
  - (1) 特許請求の範囲を別紙のとおりに訂正明 (2) 明細書第7頁第11~12行に「p-ジェ
  - (2) 明細書第7頁第11~12行に「p-ジア ルキルアミノスチルペン誘導体 」とあるを

- 1 -

方式 (土田

別紙

特許請求の範囲

- (1) エチレン性不飽和二重結合を少くとも/個有する付加重合可能な化合物および光重合開始系を含む光重合性組成物において、該光重合開始系が、
  - (a) 一般式

〔式中、 R および R は T ルキル基を示し、 Y は -0-、 -8- および - 0H = 0H - より 選ばれた 2 価原子または 原子団であつて 3 価密素 原子と共に複素芳香環 B を形成しており、 環 A は ペンゼン環またはナフタリン環であつて環 B と縮合している。

nは/または2を表わす。〕で示される<u>p</u> <u>ージアルキルアミノスチレン</u>誘導体または<u>p</u> ージアルキルアミノフエニルブタジエン 誘導体、 「pージアルキルアミノスチレン誘導体」と 訂正する。

- (3) 同年7頁第 / 3 ~ / 4 行むよび第 / 3 頁第 · / 2 ~ / 3 行に「p-ジアルキルアミノフエニルブタジエニル誘導体」とあるのを夫々「p-ジアルキルアミノフエニルブタジエン・ 誘導体」と訂正する。
- (4) 同年 / 3 頁第 / / ~ / 2 行及び年 / 4 頁第 / / ~ / 2 行 に 「 p ジ ア ルキル ア ミ ノ ス チ リ ル 誘 導体 」とあるの を 夫々 「 p ジ ア ル キ ル ア ミ ノ ス チ レ ン 誘 導体 」と 訂正 する。
- (5) 同第15頁第3~4行に「ジアルキルアミノフエニルブタジエニル誘導体」とあるのを「p-ジアルキルアミノフエニルブタジエン誘導体」と訂正する。

以 上

**–** 2 –

- (b) ヘキサアリールピイミダゾール、および
- (c) 一般式

[式中、 Z は -0- , -8- , -NH- および -cNH- より選ばれた 2 価原子または原子

団を表わす。〕で示されるチォール化合物 から成ることを特徴とする光重合性組成物。

- (2) エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合可能を化合物が、アクリル酸エステルまたはメタクリル酸エステル化合物である特許請求の範囲第/項配載の組成物。
- (3) ロージアルキルアミノスチレン は ロージアルキルアミノフエニルブタジエン 誘導体が、 2 - ( ロージアルキルアミノスチリル) - ペンゾ [4,5] ペンゾチアゾール、 2 - ( ロージアルキルアミノスチリル) - ペン ゾチアゾールまたは 2 - ( ロージアルキルア ミノスチリル) - ペンゾオキサゾールである

特許請求の範囲第/項配載の組成物。

- (4) ヘキサアリールビイミダゾールが 2,2′ービス (0-クロロフエニル) 4,4′,5,5′ーテトラフエニルビイミダゾールまたは 2,2′ービス (0-プロモフエニル) 4,4′,5,5′ーテトラフエニルビイミダゾールである 特許 請求の範囲第/項配載の組成物。
- (5) チオール化合物が、2ーメルカプトーペン メチアソールまたは2ーメルカプトーペンズ オキサゾールである特許請求の範囲第 / 項記 載の組成物。

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY